PRODUCTION OF 1-HEXENE

Publication number: JP7149672 **Publication date:** 1995-06-13

Inventor: KAWASHIMA RIICHIRO; NAKAMURA HIROFUMI;

KATSUKI SHUNJI

Applicant: MITSUBISHI CHEM CORP

Classification:

- international: B01J31/14; C07B61/00; C07C2/30; C07C11/107;

> C08F4/60; C08F4/69; C10G50/00; B01J31/12; C07B61/00; C07C2/00; C07C11/00; C08F4/00; C10G50/00; (IPC1-7): C07B61/00; C07C11/107; B01J31/14; C07C2/30; C08F4/69; C10G50/00

- European: C07C2/30

Application number: JP19930329666 19931130 Priority number(s): JP19930329666 19931130

Report a data error here

Abstract of JP7149672

PURPOSE:To obtain a process for the production of 1-hexene on an industrial scale at a low cost by the oligomerization of ethylene followed by the separation of 1-hexene from the reaction solvent by distillation and the recycling of the reaction solvent to the reaction system. CONSTITUTION:1-Hexene is produced by oligomerizing ethylene in a reaction solvent to obtain an alpha-olefin oligomer composition containing >=50-wt.% of 1-hexene, separating the 1-hexene and the reaction solvent from the reaction liquid containing the reaction solvent and the alpha-olefin oligomer composition by distillation and recycling the recovered reaction solvent to the reaction system.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-149672

(43)公開日 平成7年(1995)6月13日

(51) Int.Cl. ⁶ C 0 7 C 11/107 B 0 1 J 31/14 C 0 7 C 2/30 C 0 8 F 4/69	識別記号 X MF G	庁内整理番号 9280-4H 7508-4G	FI	技術表示箇所
C 1 0 G 50/00		6958-4H		
		審査請求	未請求 請求項	頁の数6 FD (全7頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願平5-329666		(71)出願人	
(22)出願日	平成5年(1993)11月	≣30日		三菱化学株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号
			(72)発明者	川島 理一郎 岡山県倉敷市潮通三丁目10番地 三菱化成 株式会社水島工場内
			(72)発明者	中村 宏文 岡山県倉敷市潮通三丁目10番地 三菱化成 株式会社水島工場内
			(72)発明者	
			(74)代理人	介理士 岡田 数彦

(54)【発明の名称】 1-ヘキセンの製造方法

(57)【要約】

【目的】エチレンの低重合反応による1-ヘキセンの製造方法であって、1-ヘキセンと反応溶媒との蒸留分離と反応溶媒の反応系への循環を含む工業的有利な1-ヘキセンの製造方法を提供する。

【構成】エチレンの低重合反応による1-ヘキセンの製造方法において、先ず、反応溶媒中でエチレンの低重合反応を行うことにより、1-ヘキセンの含有量が50重量%以上である $\alpha-$ オレフイン低重合体組成物を得、次いで、反応溶媒と $\alpha-$ オレフイン低重合体組成物を含有する反応液から1-ヘキセンと反応溶媒とを蒸留分離し、回収された反応溶媒を前記反応系に循環する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 エチレンの低重合反応による1-ヘキセ ンの製造方法において、先ず、反応溶媒中でエチレンの 低重合反応を行うことにより、1-ヘキセンの含有量が 50重量%以上であるα-オレフイン低重合体組成物を 得、次いで、反応溶媒と α ーオレフイン低重合体組成物 を含有する反応液から1-ヘキセンと反応溶媒とを蒸留 分離し、回収された反応溶媒を前記反応系に循環するこ とを特徴とする1-ヘキセンの製造方法。

属アミドとアルキルアルミニウム化合物の組み合わせか ら成る触媒系を使用してエチレンの低重合反応を行う請 求項1に記載の1-ヘキセンの製造方法。

【請求項3】 クロム化合物とアルキルアルミニウム化 合物とが予め接触しない態様でエチレンとクロム系触媒 とを接触させる請求項2に記載の1-ヘキセンの製造方 法。

【請求項4】 反応溶媒が炭素数7以下の直鎖状飽和炭 化水素または脂環式飽和炭化水素である請求項1~3の 何れかに記載の1-ヘキセンの製造方法。

【請求項5】 反応温度が70℃以下である請求項1~ 4の何れかに記載の1-ヘキセンの製造方法。

【請求項6】 反応液から1-ヘキセンと反応溶媒とを 蒸留分離するに先立ち、反応液中の副生ポリマーの分離 除去を行う請求項1~5の何れかに記載の1-ヘキセン の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、1-ヘキセンの製造方 応による1-ヘキセンの製造方法であって、1-ヘキセ ンと反応溶媒との蒸留分離と反応溶媒の反応系への循環 を含む工業的有利な1-ヘキセンの製造方法に関するも のである。

[00002]

【従来の技術】従来から、α-オレフインの低重合反応 により、各種の原料として有用なα-オレフイン低重合 体が得られている。例えば、エチレンの低重合反応によ って1-ヘキセンを含有するα-オレフイン低重合体組 体組成物から蒸留により回収される1-ヘキセンは、線 状低密度ポリエチレン(L-LDPE)等の有用なポリ マーの原料モノマーとして利用される。

【0003】ところで、エチレン等のα-オレフインの 低重合方法として、特定のクロム化合物と特定の有機ア ルミニウム化合物の組み合せから成るクロム系触媒を使 用する方法が知られている。例えば、特公昭43-18 707号公報には、一般式MXnで表され、クロムを含 むVIA族の遷移金属化合物(M)とポリヒドロカルビ エチレンから1-ヘキセンを得る方法が記載されてい

【0004】また、特開平3-128904号公報に は、クロムーピロリル結合を有するクロム含有化合物と 金属アルキル又はルイス酸とを予め反応させて得られた 触媒を使用してαーオレフインを三量化する方法が記載 されている。

【0005】ところが、従来公知の方法によって得られ る反応生成組成物は、4~8の炭素数を有する重合体の 【請求項2】 少なくともクロム化合物とアミン又は金 10 含有量が75重量%以下であり、その他に各種の炭素数 の重合体を含有している。例えば、4の炭素数を有する 重合体について「C4」の記号で表せば、本発明者の追 試によって確認された典型的な組成の一例は、C4:1 9%, C6:40%, C8:16%, C10:13%, C12:7%, C14:3%, C16:1%, C18: 1%である。なお、大部分の各重合体は、α-オレフイ ンである。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、 $\alpha - \pi$ 20 レフインの低重合反応は、通常、反応溶媒中で行われる が、上記の様に、得られる反応生成組成物が相互の分離 が困難な構成成分を多数含有する場合は、次の様な問題 がある。すなわち、α-オレフインの低重合反応を工業 的有利に実施せんとした場合、反応溶媒は、回収されて 反応系に循環されるが、反応溶媒の蒸留分離の負荷が大 きいため、反応溶媒の循環使用の利益が軽減される。

【0007】本発明は、上記実情に鑑みなされたもので あり、その目的は、エチレンの低重合反応による1-へ キセンの製造方法であって、1-ヘキセンと反応溶媒と 法に関するものであり、詳しくは、エチレンの低重合反 30 の蒸留分離と反応溶媒の反応系への循環を含む工業的有 利な1-ヘキセンの製造方法を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、上記の目 的を達成すべく鋭意検討を重ねた結果、1-ヘキセン以 外の α -オレフイン低重合体の副生を抑制し、1-ヘキ センを高収率で得ることに成功し、本発明を完成するに 至った。すなわち、本発明の要旨は、エチレンの低重合 反応による1-ヘキセンの製造方法において、先ず、反 応溶媒中でエチレンの低重合反応を行うことにより、1 成物が得られる。そして、斯かる α - オレフイン低重合 40 - ヘキセンの含有量が 5 0 重量%以上である α - オレフ イン低重合体組成物を得、次いで、反応溶媒とα-オレ フイン低重合体組成物を含有する反応液から1-ヘキセ ンと反応溶媒とを蒸留分離し、回収された反応溶媒を前 記反応系に循環することを特徴とする1-ヘキセンの製 造方法に存する。

【0009】以下、本発明を詳細に説明する。本発明に おいては、高収率かつ高選択率で1-ヘキセンを製造す るため、例えば、少なくとも、クロム化合物とアミン又 は金属アミドとアルキルアルミニウム化合物の組み合わ ルアルミニウムオキシド(X)から成る触媒系により、 50 せから成るクロム触媒系を使用する。斯かるクロム触媒

(3)

系は、後述の様に、クロム化合物とアルキルアルミニウ ム化合物とが予め接触しない態様でエチレンとクロム系 触媒とを接触させるのが好ましい。

【0010】クロム化合物は、一般式CrXnで表され る。但し、一般式中、Xは、任意の有機基または無機の 基もしくは陰性原子、nは1~6の整数を表し、そし て、nが2以上の場合、Xは同一または相互に異なって いてもよい。クロムの価数は0価ないし6価であり、上 記の式中のnとしては2以上が好ましい。

【0011】 有機基としては、炭素数が通常1~30の 10 フェン、ジメチルスルフィド等が例示される。 各種の基が挙げられる。具体的には、炭化水素基、カル ボニル基、アルコキシ基、カルボキシル基、β-ジケト ナート基、β-ケトカルボキシル基、β-ケトエステル 基およびアミド基などが例示れる。炭化水素基として は、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アル キルアリール基、アラルキル基など等が挙げられる。無 機の基としては、硝酸基、硫酸基などのクロム塩形成基 が挙げられ、陰性原子としては、酸素、ハロゲン等が挙 げられる。

キシ塩、カルボキシル塩、β-ジケトナート塩、β-ケ トエステルのアニオンとの塩、または、クロムハロゲン 化物であり、具体的には、クロム(IV)tert-ブトキシ ド、クロム(III) アセチルアセトナート、クロム(III) トリフルオロアセチルアセトナート、クロム(III) ヘキ サフルオロアセチルアセトナート、クロム(III)(2, 2, 6, 6-テトラメチル-3, 5-ヘプタンジオナー ト)、Cr (PhCOCHCOPh)。(但し、ここでP hはフェニル基を示す。)、クロム(II)アセテート、ク ロム(III) アセテート、クロム(III) 2-エチルヘキサ 30 -ケトカルボン酸塩、アミド錯体、カルボニル錯体、カ ノエート、クロム(III) ベンゾエート、クロム(III) ナ フテネート、Cr (CH3 COCHCOOCH3)3 、塩 化第一クロム、塩化第二クロム、臭化第一クロム、臭化 第二クロム、ヨウ化第一クロム、ヨウ化第二クロム、フ ッ化第一クロム、フッ化第二クロム等が挙げられる。

【0013】また、上記のクロム化合物と電子供与体か ら成る錯体も好適に使用することが出来る。電子供与体 としては、窒素、酸素、リン又は硫黄を含有する化合物 の中から選択される。

ン、アミド等が挙げられ、具体的には、アセトニトリ ル、ピリジン、ジメチルピリジン、ジメチルホルムアミ ド、N-メチルホルムアミド、アニリン、ニトロベンゼ ン、テトラメチルエチレンジアミン、ジエチルアミン、 イソプロピルアミン、ヘキサメチルジシラザン、ピロリ ドン等が挙げられる。

【0015】酸素含有化合物としては、エステル、エー テル、ケトン、アルコール、アルデヒド等が挙げられ、 具体的には、エチルアセテート、メチルアセテート、テ トラヒドロフラン、ジオキサン、ジエチルエーテル、ジ 50 持を省略でき、しかも、担体の使用による総触媒使用量

メトキシエタン、ジグライム、トリグライム、アセト ン、メチルエチルケトン、メタノール、エタノール、ア セトアルデヒド等が挙げられる。

【0016】リン含有化合物としては、ヘキサメチルフ ォスフォルアミド、ヘキサメチルフォスフォラストリア ミド、トリエチルフォスファイト、トリブチルフォスフ ィンオキシド、トリエチルフォスフィン等が例示され る。一方、硫黄含有化合物としては、二硫化炭素、ジメ チルスルフォキシド、テトラメチレンスルフォン、チオ

【0017】従って、クロム化合物と電子供与体から成 る錯体例としては、ハロゲン化クロムのエーテル錯体、 エステル錯体、ケトン錯体、アルデヒド錯体、アルコー ル錯体、アミン錯体、ニトリル錯体、ホスフィン錯体、 チオエーテル錯体などが挙げられる。具体的には、Cr Cl3 · 3THF, CrCl3 · 3dioxane, C $rCl_3 \cdot (CH_3 CO_2 n-C_4 H_9)$, $CrCl_3$ · (CH₃ CO₂ C₂H₅), CrCl₃ · 3 (i − C 8 H7 OH), CrCl3 · 3 [CH3 (CH2) 8 C 【0012】好ましいクロム化合物は、クロムのアルコ 20 H (C2 H5) CH2 OH]、CrCl3・3 pyri dine, $CrCl_3 \cdot 2 (i-C_3 H_7 NH_2)$, [CrCl₃ · 3CH₃ CN] · CH₃ CN, CrCl 3 · 3 P P h 3 、 C r C l 2 · 2 T H F 、 C r C l 2 · 2 pyridine, CrC12 • 2 [(C2 H5)2 N H], $CrCl_2 \cdot 2CH_8 CN$, $CrCl_2 \cdot 2$ [P (CH₃) 2 Ph] 等が挙げられる。

【0018】クロム化合物としては、炭化水素溶媒に可 溶な化合物が好ましく、クロムのβ-ジケトナート塩、 カルボン酸塩、 β – ケトエステルのアニオンとの塩、 β ルベン錯体、各種シクロペンタジエニル錯体、アルキル **錯体、フェニル錯体などが挙げられる。クロムの各種力** ルボニル錯体、カルベン錯体、シクロペンタジエニル錯 体、アルキル錯体、フェニル錯体としては、具体的に は、Cr (CO) 6、 (C6 H 6) Cr (CO) 8、 (CO) $_5$ Cr (= CCH $_3$ (OCH $_3$)), (CO) $_5$ Cr (= CC $_6$ H $_5$ (OCH $_3$)), CpCrC1 $_2$ (ここでCpはシクロペンタジエニル基を示す。)、(Cp* CrClCH3)2 (ここでCp* はペンタメチル 【0014】窒素含有化合物としては、ニトリル、アミ 40 シクロペンタジエニル基を示す。)、(CH3)2 CrC 1等が例示される。

> 【0019】クロム化合物は、無機酸化物などの担体に 担持して使用することも出来るが、担体に担持させず に、他の触媒成分と組み合わせて使用するのが好まし い。すなわち、エチレンの後述する好ましい低重合反応 に従い、特定の接触態様でクロム系触媒を使用するなら ば、クロム化合物の担体への担持を行わなくとも高い触 媒活性が得られる。そして、クロム化合物を担体に担持 させずに使用する場合は、複雑な操作を伴う担体への担

(担体と触媒成分の合計量) の増大と言う問題をも回避 することが出来る。

【0020】クロム系触媒で使用するアミンは、1級ま たは2級のアミンである。1級アミンとしては、アンモ ニア、エチルアミン、イソプロピルアミン、シクロヘキ シルアミン、ベンジルアミン、アニリン、ナフチルアミ ン等が例示され、2級アミンとしては、ジエチルアミ ン、ジイソプロピルアミン、ジシクロヘキシルアミン、 ジベンジルアミン、ビス (トリメチルシリル) アミン、 ピロール、2、5-ジメチルピロール、3、4-ジメチ ルピロール、3、4 - ジクロロピロール、2、3、4、 5-テトラクロロピロール、2-アシルピロール、ピラ ゾール、ピロリジン等が例示される。

【0021】クロム系触媒で使用する金属アミドは、1 級または2級のアミンから誘導される金属アミドであ り、具体的には、1級または2級のアミンとIA族、I IA族、IIIB族およびIVB族から選択される金属 との反応により得られるアミドである。斯かる金属アミ ドとしては、具体的には、リチウムアミド、ナトリウム 20 るアルキルアルミニウム化合物が好適に使用される。 エチルアミド、カルシウムジエチルアミド、リチウムジ イソプロピルアミド、カリウムベンジルアミド、ナトリ*

 R^1 , A 1 (O R^2) , H_p X_q

【0024】式中、R¹ 及びR² は、炭素数が通常1~ 15、好ましくは1~8の炭化水素基であって互いに同 ーであっても異なっていてもよく、Xはハロゲン原子を 表し、mは $0 \le m \le 3$ 、nは $0 \le m \le 3$ 、pは $0 \le p \le m$ 3、qは $0 \le q < 3$ のそれぞれの数であって、しかも、 m+n+p+q=3である数を表す。

【0025】上記のアルキルアルミニウム化合物として 30 は、例えば、下記一般式(2)で示されるトリアルキル※

*ウムビス(トリメチルシリル)アミド、リチウムインド リド、ナトリウムピロライド、リチウムピロライド、カ リウムピロライド、カリウムピロリジド、アルミニウム ジエチルピロライド、エチルアルミニウムジピロライ ド、アルミニウムトリピロライド等が挙げられる。

【0022】上記の中、2級のアミン、2級のアミンか ら誘導される金属アミド又はこれらの混合物が好適に使 用される。特には、2級のアミンとしては、ピロール、 2, 5-ジメチルピロール、3, 4-ジメチルピロー モルホリン、イミダゾール、インドリン、インドール、 10 ル、3,4-ジクロロピロール、2,3,4,5-テト ラクロロピロール、2-アシルピロール、2級のアミン から誘導される金属アミドとしては、アルミニウムピロ ライド、エチルアルミニウムジピロライド、アルミニウ ムトリピロライド、ナトリウムピロライド、リチウムピ ロライド、カリウムピロライドが好適である。そして、 ピロール誘導体の中、ピロール環に炭化水素基を有する 誘導体が特に好ましい。

> 【0023】上記のクロム系触媒において、アルキルア ルミニウム化合物としては、下記一般式(1)で示され

【化1】

··· (1)

※アルミニウム化合物、一般式(3)で示されるハロゲン 化アルキルアルミニウム化合物、一般式(4)で示され るアルコキシアルミニウム化合物、一般式(5)で水素 化アルキルアルミニウム化合物などが挙げられる。な お、各式中のR1、XおよびR2の意義は前記と同じで

[0026]

【化2】

 \cdots (2) R13 A 1 $R^{1} \, \mathbb{I} \, A \, 1 \, X_{3} \, \mathbb{I} \, (m \, \text{td} \, 1. \, 5 \leq m \leq 3)$ ··· (3)

 R^1 m $A 1 (O R^2)$ 3-m

(mは0 < m < 3、好ましくは1. $5 \le m < 3$) ··· (4)

R¹ m A 1 H_{3-m} ··· (5)

(mは0 < m < 3、好ましくは1. $5 \le m < 3$)

【0027】上記のアルキルアルミニウム化合物の具体 例としては、トリメチルアルミニウム、トリエチルアル ミニウムモノクロリド、ジエチルアルミニウムエトキシ ド、ジエチルアルミニウムヒドリド等が挙げられる。こ れらの中、ポリマーの副生が少ないと言う点でトリアル キルアルミニウムが特に好ましい。

【0028】本発明においては、先ず、上記の各触媒成 分から成る触媒系を使用して反応溶媒中でエチレンの低 重合反応を行う。斯かる低重合反応により、1-ヘキセ ンを含有する α - オレフイン低重合体組成物が得られ る。そして、α-オレフイン低重合体組成物中の1-ヘ キセンの含有量は、少なくとも50重量%であり、75 50 の範囲とされる。

重量%以上、更には85重量%以上に高めることが出来

ミニウム、トリイソプチルアルミニウム、ジエチルアル 40 【0029】クロム化合物の使用量は、溶媒1リットル 当たり、通常 0. 1×10⁻³~5g、好ましくは1. 0 ×10⁻³~2gの範囲とされる。一方、アルキルアルミ ニウム化合物の使用量は、クロム化合物1g当たり、通 常0.1mmo1以上であるが、触媒活性および三量体 の選択率の観点から、5mmol以上とするのがよい。 そして、上限は、通常50mo1である。また、アミン 又は金属アミドの使用量は、クロム化合物1g当たり、 通常 0. 001 当量以上であり、好ましくは 0. 005 ~1000当量、更に好ましくは0.01~100当量

【0030】エチレンとクロム系触媒との接触は、クロ ム化合物とアルキルアルミニウム化合物とが予め接触し ない態様で行うのが好ましい。斯かる接触態様によれ ば、選択的に三量化反応を行わせ、原料エチレンから1 - ヘキセンを高収率で得ることが出来る。

【0031】上記の特定の接触態様は、具体的には、 「アミン又は金属アミド」についてアミンを以て表した 場合、(1)アミン及びアルキルアルミニウム化合物を 含む溶液中にエチレン及びクロム化合物を導入する方 チレン及びアルキルアルミニウム化合物を導入する方 法、(3) クロム化合物を含む溶液中にエチレン、アミ ン及びアルキルアルミニウム化合物を導入する方法、

(4) アルキルアルミニウム化合物を含む溶液中にエチ レン、クロム化合物およびアミンを導入する方法、

(5) クロム化合物、アミン、アルキルアルミニウム化 合物およびエチレンをそれぞれ同時かつ独立に反応器に 導入する方法などによって行うことが出来る。そして、 上記の各溶液は、反応溶媒を使用して調製される。

ルキルアルミニウム化合物とが予め接触しない態様」と は、反応の開始時のみならず、その後の追加的なエチレ ン及び触媒成分の反応器への供給においても斯かる態様 が維持されることを意味する。

【0033】クロム化合物とアルキルアルミニウム化合 物とが予め接触する態様でクロム系触媒を使用した場合 にエチレンの低重合反応の活性が低くなる理由は、未だ 詳らかではないが、次の様に推定される。

【0034】すなわち、クロム化合物とアルキルアルミ 配位子とアルキルアルミニウム化合物中のアルキル基と の間で配位子交換反応が進行すると考えられる。そし て、斯かる反応によって生成するアルキルークロム化合 物は、通常の方法で生成するアルキルークロム化合物と 異なり、それ自身不安定である。そのため、アルキルー クロム化合物の分解還元反応が優先して進行し、その結 果、エチレンの低重合反応には不適当な脱メタル化が惹 起され、エチレンの低重合反応の活性が低下する。

【0035】本発明において、溶媒としては、ブタン、 サン、メチルシクロヘキサン、デカリン等の直鎖状また は脂環式の飽和炭化水素、ベンゼン、トルエン、キシレ ン、エチルベンゼン、メシチレン、テトラリン等の芳香 族炭化水素、クロロホルム、四塩化炭素、塩化メチレ ン、ジクロロエタン、トリクロロエタン、テトラクロロ エタン等の鎖状塩素化炭化水素、クロロベンゼン、ジク ロロベンゼン等の塩素化芳香族炭化水素などが使用され る。これらは、単独で使用する他、混合溶媒として使用 することも出来る。

【0036】特に、溶媒としては、炭素数が4~7の直 50 以外のα-オレフインを蒸留分離した反応溶媒の全量を

鎖状飽和炭化水素または脂環式飽和炭化水素が好まし い。これらの溶媒を使用することにより、ポリマーの副 生を抑制することが出来、更に、脂環式炭化水素を使用 した場合は、高い触媒活性が得られると言う利点があ

【0037】反応温度としては、0~70℃の範囲が好 ましい。反応溶媒として、炭素数が7以下の直鎖状飽和 炭化水素、具体的には、ヘキサン又はヘプタンを使用 し、70℃以下の反応温度を採用するならば、反応液中 法、(2)クロム化合物およびアミンを含む溶液中にエ 10 の副生ポリマーの形状が顆粒状となり、副生ポリマーの 固液分離を容易に行うことが出来る。一方、反応圧力 は、常圧ないし250kg/cm2の範囲から選択し得 るが、通常は、100kg/cm2の圧力で十分であ る。そして、滞留時間は、通常1分から20時間、好ま しくは0.5~6時間の範囲とされる。また、反応形式 は、回分式、半回分式または連続式の何れであってもよ く、反応時に水素を共存させるならば、触媒活性および 三量体の選択率の向上が認められので好ましい。

【0038】次いで、本発明においては、反応溶媒と a 【0032】なお、上記において、「クロム化合物とア 20 -オレフイン低重合体組成物を含有する反応液から1-ヘキセンと反応溶媒とを蒸留分離する。そして、本発明 の好ましい態様においては、蒸留分離するに先立ち、反 応液中の副生ポリマーの分離除去を行う。

【0039】反応液中の副生ポリマーの分離除去は、公 知の固液分離装置を適宜使用し、副生ポリマーを溶融さ せることなく行われる。固液分離装置としては、濾過機 または遠心分離機を使用するのが好ましい。そして、副 生ポリマーが顆粒状の場合、その分離除去先立ち、反応 液を攪拌して副生ポリマーを分散させるならば、副生ポ 二ウムを接触させた場合、クロム化合物に配位している 30 リマーの粒径をコントロールすることが出来る。一方、 1-ヘキセンと反応溶媒との蒸留分離は、公知の蒸留装 置を使用して行われる。蒸留形式は、回分式または連続 的の何れであってもよく、1-ヘキセンは、通常、蒸留 塔の塔頂から留出される。

【0040】次いで、本発明においては、回収された反 応溶媒を前記反応系に循環する。蒸留塔の缶出液として 回収された反応溶媒の場合は、1-ヘキセン以外のα-オレフインを含有している。しかしながら、本発明にお いては、 α - オレフイン低重合体組成物中の1 - ヘキセ ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、シクロヘキ 40 ンの含有量は通常50重量%以上であり、しかも、その 含有量を75重量%以上、更には85重量%以上に高め ることが出来るため、回収された反応溶媒中の1-ヘキ セン以外のα-オレフインの含有量は低い。

> 【0041】従って、本発明においては、反応系内にお ける1-ヘキセン以外のα-オレフインの含有量が所定 の濃度に達するまでの間は1-ヘキセンの蒸留分離で回 収された反応溶媒をそのまま反応系に循環することも出 来る。また、αーオレフインを含有する反応溶媒の一部 を反応系に循環することも出来る。勿論、1-ヘキセン

反応系に循環することも出来る。この場合、蒸留分離 は、上記と同様に行われるが、反応溶媒中の上記のα-オレフインの含有量は低いため、蒸留負荷は大幅に軽減

[0042]

【実施例】以下、本発明を実施例により更に詳細に説明 するが、本発明は、その要旨を越えない限り以下の実施 例に限定されるものではない。

【0043】実施例1

クレーブを熱時に組み立てた後、真空窒素置換した。こ のオートクレーブには破裂板を備えた触媒フィード管を 備えた攪拌機を取り付けておいた。n-ヘプタン(98 0m1)、ピロール (1.244mmol) のn-ヘプ タン溶液、トリエチルアルミニウム(8.000mmo 1)のn-ヘプタン溶液をオートクレーブの胴側に仕込 み、一方、触媒フィード管にn-ヘプタンにて溶液化し たクロム(III) 2-エチルヘキサノエート (200m g、0.420mmo1)を仕込んだ。n-ヘプタンの 全体量は1リットルであった。

【0044】先ず、オートクレーブを60℃に加熱し、 次いで、60℃でエチレンを触媒フィード管より導入し た。エチレン圧により破裂板が破裂し、クロム化合物が オートクレーブ胴側に導入されてエチレンの低重合が開 始された。全圧が35Kg/cm²となる迄エチレンを 導入し、その後、全圧を35Kg/cm²に、温度を6 0℃に維持した。1時間後、オートクレーブ中にエタノ ールを圧入して反応を停止した。

【0045】オートクレーブの圧力を解除して脱ガスを 行った後、濾過機によって反応液中の副生ポリマー(主 30

としてポリエチレン)を分離除去して反応溶媒とα-オ レフイン低重合体組成物を含有する反応液を回収した。 なお、本実施例においては、副生ポリマーの形状は顆粒 状であり、極めて良好に濾過操作を行うことが出来た。 ガスクロマトグラフによる α-オレフイン低重合体の組 成分析の結果などを表1に示した。

10

【0046】次いで、上記の回収された反応液から1-ヘキセンと反応溶媒とを蒸留分離し、回収された反応溶 媒を前記反応系にそのまま循環し、n-ヘプタンの全体 150℃の乾燥器で加熱乾燥した2.4 リットルのオート 10 量が1リットルとなる条件下に、上記と同様の反応を繰 り返した。2度目の反応において得られたαーオレフイ ン低重合体の組成は、上記の1度目における組成と概略 同一であった。

【0047】実施例2

実施例1において、表1に示す反応条件を採用した以外 は、実施例1と同様に操作し、エチレンの低重合反応を 2回行い、それぞれα-オレフイン低重合体組成物を得 た。1度目の反応において得られたα-オレフイン低重 合体の組成分析の結果などを表1に示した。2度目の反 20 応において得られた αーオレフイン低重合体の組成は、 1度目における組成と概略同一であった。

【0048】表中、溶媒種類の「HP」はn-ヘプタン を表し、触媒効率の単位は、 $g-\alpha-$ オレフイン/1g-クロム化合物、触媒活性の単位は、g-α-オレフイ ン/1g-クロム・Hrである。また、触媒成分モル比 は、Cr化合物:ピロール:トリエチルアルミニウムの モル比を表す。

[0049]

【表1】

_	実 施 例		
	1	2	
容媒種類(量:L)	HP(1)	HP(1)	
反応温度 (℃)	60	60	
#媒成分モル比	1:3:20	1:3:5	
にチレン圧(Kg/cm²)	35	35	
反応時間(Hr)	1.0	1.0	
〈生成物量(g) >	102.6	57.4	
<組成分布(₩t%) >			
C ₄	15.3	2.7	
C6 全体	74.2	90.2	
C。中の1-hexen 含量(wt%)	95. 7	99.2	
C8	3.1	2.5	
C10-20	6.8	4.3	
222-30	0	0.1	
Vax	0	0	
(PE>	0.6	0.4	
〈触媒効率〉	441	287	
〈触媒活性〉	4239	2758	

(7) 特開平7-149672

11 12

[0050]

【発明の効果】以上説明した本発明によれば、特定のクロム系触媒を使用することにより、1-ヘキセン以外の $\alpha-$ オレフイン低重合体の副生を抑制して1-ヘキセン

を高収率で得ることが出来るため、反応系へ循環使用する反応溶媒の蒸留回収を低負荷で実施することが出来る

フロントページの続き

// C07B 61/00

300

技術表示箇所

-621-